

# ラジアルシェア干渉計を用いる粗面の形状計測\*

安達正明\*\* 大杉博人\*\*\* 平林 崇† 稲部勝幸††

Shape Measurement Method of Rough Surface using a Radial Shearing Interferometry

Masaaki ADACHI, Hiroto OOSUGI, Takashi HIRABAYASHI and Katsuyuki INABE

A new shape measurement method of rough surface is proposed. The method utilizes a radial shearing interferometry consisting of two zoom lenses with different magnifying powers and a laser diode being able to change its wavelength in a small range less than 0.1 nm. The radial shearing interferometry, known as a kind of common path interferometer, is capable of obtaining a very stable specklegram even under normal vibrational circumstance. From the specklegrams two phase maps corresponding to two slightly different laser wavelengths are extracted. The difference of phase values between two maps is nearly independent of random speckle phase, but depends on optical path differences. Then shape of the rough surface can be calculated from the two phase maps through the optical path differences. The validity of the method is experimentally demonstrated. **Key words:** rough surface, shape measurement, radial shearing interferometry, laser diode, phase shifting

### 1. 緒 言

光を用いる粗面の形状計測では光の直進性を利用するモアレ 法や光切断法が広く用いられている.これらは測定できる空間 範囲が広く大型物体も対象とし得るが、測定原理から照明方向 と観測方向に角度を持たせる必要がある<sup>1120</sup>.その結果、深い凹 凸を持つ物体では陰が生じやすいという欠点が存在する.一方、 光の干渉を用いる形状測定法は照明と観測を同方向から行うこ とができて非常に高精度である反面、測定範囲が前後方向に数 +μ m以下と狭く測定対象が光学面に限られるなどの制限がこ れまではあった.

近年,波長を容易に変えることのできる高出力な半導体レー ザが出現して上記の状況は大きく変化した。粗面を対象とする 場合でも干渉を用いて照明と観測を同方向に取りながら形状計 測を行い得る道が開かれたのである。そして2波長や3波長の レーザ光を用いた粗面形状の測定法が報告され始めた<sup>3)4</sup>. さら に非常に広い波長範囲(数+nm前後)でも連続して波長変更 のできる特殊な最新の半導体レーザ素子を用いる連続広域波長 走査を利用する方法<sup>5)</sup>も提案され始めた。後者は光学系からの 絶対距離も測定可能な方法であり、精度の高さなどからも注目 される.

これら光干渉を用いる方法は使用する半導体レーザがこれま でのレーザ光源に比べ極めて低消費電力でコンパクトなこと、 さらには半導体レーザ製造技術とその性能が今後も改善されて より安価で高性能な製品の出現が予想されることなどから、将 来広く普及すると考えられる.この意味で現時点で非常に注目 される研究開発テーマと言える.

しかし干渉を用いる粗面形状計測には普及に際し解決される べき大きな問題点が少なくとも1つある.それは光干渉を用い ており、一方で作動距離(測定器と被測定物間の距離)が長く

- \* 原稿受付 平成11年11月8日
- \*\* 正会員 金沢大学大学院(金沢市小立野 2~40-20)
- \*\*\* 大同工業(株) (加賀市熊坂町)
  - † (株)デンソー (刈谷市昭和町)
- + + 金沢大学工学部

なるため、測定系が空気じょう乱や外部振動の影響を受けやす くなって測定環境が限られるということである.我々はこの問 題の重要性を考慮し解決法の1つの可能性を探る意味で、今回 環境の影響を受けにくいラジアルシェア干渉計を用いる粗面形 状計測法の研究を行った.ラジアルシェア干渉計では空気じょ う乱や外部振動の影響を受やすい測定光学系と被測定物の間が 共通光路となり、空気じょう乱等が光路差すなわち干渉画像に 影響しにくい.このため鏡面のインプロセス形状計測にその応 用研究がなされてもいる<sup>60</sup>.2次元的変化を持つ粗面のラジア ルシェア干渉計を応用する形状計測法の研究は我々の知る限り まだ発表されたものはなく、本研究は粗面物体を正面から長い 作動距離で形状測定する手法の研究に道を開くものと考える.

今回は干渉光源に波長変更が狭い範囲 (< 0.1nm) だが可能 であり出力が大きい(50 mW) 半導体レーザを用いた.そして 近接する2波長(782.30nm,782.36nm)で位相シフト法(ハ リハラン法<sup>77</sup>)による位相測定を行っている.スペックル干渉 では粗面反射の関係する位相が未知数として干渉画像の位相に 影響する.この未知数を除去するため2波長を用いた位相測定 では1つの位相図しか得られない<sup>344</sup>.そこで我々は測定対象を 連続する粗面を持つ形状に限った.ただし提案するラジアル シェア干渉計を用いる形状計測の原理は,連続広域波長走査や 段差測定を可能にする3波長を用いる測定にも拡張できると考 えている.

## 2. 湧 定 原 理

光干渉を用いた形状計測では、形状の情報を光路差情報を介 して位相情報としてコンピュータに取り込む必要がある。一般 にレーザ波長はサプミクロンであるから、光路差が振動や空気 のじょう乱によりほんの少し(0.1 μ m 前後)変化しても位相は 大きく変化する(干渉顕微鏡ではこのため干渉計部分を高剛性 に作る).通常,粗面物体の形状計測では測定対象物が大きく (干渉顕微鏡で測定する物体と比較して)作動距離も長い.そ の結果非常に外乱の影響を受けやすくなる.

この外乱の影響を受けにくくする光干渉法として発展してき たのが共通光路干渉計である.干渉を与える2つの光路がほぼ



**Fig.1** Shear directions **b**, **c**, **d** in a radial shear image. f(x,y) is a contour of original object and f(ax,ay) (a<1.0) is of an enlarged one. A center of the object coincides with the corresponding point of the enlarged one

同じ空間位置で同じ反射物体から作られるため,振動や空気じょ う乱は両方の光路にほとんど等しく影響し,その結果光路差に は影響しにくい.そこで我々は最も簡単な共通光路干渉計であ る一方向のみへのシェア干渉計を用いる形状計測法をこれまで 研究してきた<sup>®</sup>.しかし一方向のみにシェアする(ずらす)た めシェア方向の形状計測しか行い得ず,全方向に形状変化を持 つ物体を測定するときは最初にあるシェア方向で測定を行い,次 に最初の方向と直角にシェア方向を変更して再度測定を行って, 最後に2つの測定データから2次元形状を復元する必要があっ た.

この複雑さを解消し測定途中のシェア方向変更作業での誤差 混入を避ける方法として研究したのが今回報告するラジアルシェ ア干渉計を用いる形状計測法である<sup>9</sup>.

ラジアルシェア干渉では同一物体から作られる拡大倍率の異 なる2つの像を用いる.2つの像を観察視野の中心付近で同じ 部分が来るように重ね,視野中心以外では結果として一方の像 に対しもう一方の像を視野中心から遠ざかる方向にシェアさせ て干渉させる方法である.図1に示すのはラジアルシェア干渉 で見られる2つの物体像のモデル図である.モデル物体はラグ ビーボールのような回転楕円体形状を想定している.f(x.y)で示 すものは倍率が1で,f(ax.ay)(a<1.0)で示すものは倍率が約 1.5と大きく,それらは視野中心で同一部分が重なって配置され る.ここで,b,c,dはそのベクトル上におけるシェア方向と なる.

次にこの二重像から像の粗面形状を求める方法を述べる.以下,式(3)までの二重像間隔から3次元形状を復元する方法は文献6)で報告されているデータ処理法と基本的に同じである.ここではより簡単な表現とし半導体レーザからの2波長の使用方法も含めた全方向の形状測定法を述べる.図2に示す2つの曲線を図1のb方向にシェアされた横倍率の異なる2つの像の断面形状f(x)とf(ax)とする(y=0なので表現を簡略化してf(x,0)=f(x)と置く).ここで1/a(a<1.0)は倍率の大きい像の拡大率である.この時,視野中心からxの位置での像表面の間隔g(x)は次式で与えられる.

$$g(x) = f(ax) - f(x) \tag{1}$$

この式に x= ax ならびに x= a'x (1=2,3,4,・・)を代入すると



Fig.2 Sectional profiles on the x axis for the original object and the enlarged one. z is height. g(x) is the distance between the original surfac f(x) and the enlarged surface f(ax)

式(1)はそれぞれ

$$g(ax) = f(a^{2}x) - f(ax)$$
  

$$g(a^{2}x) = f(a^{3}x) - f(a^{2}x)$$
  

$$g(a^{3}x) = f(a^{4}x) - f(a^{3}x)$$
(2)

となる. これらすべての式を上下に加えあわせると次の式(3)が 得られる.

$$\sum_{i=0}^{n} g(a^{i}x) = f(a^{n+1}x) - f(x)$$
(3)

この式で右辺の第1項はαがα<1.0であるからnが十分大き な値を採るとき測定原点(視野中心)の断面データとなり,第 2項は測定したい箇所の断面データとなる.一方で左辺は二重 像の表面の間隔からコンピュータで簡単に計算される量である. 故に図2のf(x)を包含する area D の領域データが求められれば 形状計測が可能となる.

次に図2に示す二重の像表面が作る間隔を半導体レーザを用いて測定する方法を述べる。半導体レーザは波長が可変である。 まず波長入<sub>1</sub>のレーザ光で像表面の間隔g(x)が作る光路差2g(x)の干渉像に関して、ハリハラン法(対雑音性の良い位相シフト法として知られる<sup>7</sup>)により位相 $\psi_1(x)$ を求めると $\psi_1(x)$ は次式となる。

$$\psi_1(x) = \frac{2\pi}{\lambda_1} [2 \cdot g(x) + B] + \phi_1(x) \tag{4}$$

ここで $\phi_1(x)$ は粗面での反射で生じる空間的にランダムな値を とる位相の成分であり、また Bは用いる干渉光学系が構造上持 つ光路差である. 同様に波長 $\lambda_2$ を用いて位相 $\psi_2(x)$ を求める と次式となる.

$$\Psi_{2}(x) = \frac{2\pi}{\lambda_{2}} [2 \cdot g(x) + B] + \phi_{2}(x)$$
 (5)

ここで $\lambda_1 = \lambda_2$  (実験では $\lambda_1 = 782.30$ nm,  $\lambda_2 = 782.36$ nmを使用) として位相の粗面反射によるランダム成分を $\phi_1(x) = \phi_2(x)$  と仮定<sup>10)</sup>すると、 $\psi_{12}(x) = \psi_1(x) - \psi_2(x)$ で与えられる $\psi_{12}(x)$ 



Fig.3 Optical layout of a radial shearing interferometry and a light source. An object is illuminated along the same direction to measurement one. Dotted lines mean a contour of black plastic cover of the interferometry

は次のようになる.

$$\Psi_{12}(x) = 2\pi \left[2 \cdot g(x) + B\right] \cdot \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right) \tag{6}$$

これらの値は光路差:2g(x) +Bを波長λ '= 1/(1/λ<sub>1</sub>-1/λ<sub>2</sub>) を用いて干渉測定したときに得られる位相と同じである.

ところで位相シフト法による2波長での位相測定では波長を 変える前後で複数枚の画像を取り込む必要がある.このため波 長で測定時間が少しずれ,光路差 Bがいつも同じになるとは言 えない.また我々が欲しいのはg(x)だけである.故に $\psi_{12}(x)$ で はなく $\psi_{12}(x)=\psi_{12}(x)-\psi_{12}(0)$ で与えられる $\psi_{12}(x)$ を考えた. g(x)は式(1)よりg(0)=0であるので $\psi_{12}(x)$ は次式となる.

$$\psi_{12}'(x) = 4\pi \cdot g(x) \cdot \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right) \tag{7}$$

このψ<sub>12</sub>(x)と入<sub>1</sub>=782.30nm, 入<sub>2</sub>=782.36nm を用いて式(7) から g(x)を算出し、アンラップ(3.2 測定結果の節を参照のこ と)後に式(3)から最終的に b 方向の粗面形状 f(x) を求める.

b 方向以外の任意の方向の形状に関しても図1から分かるようにその方向にシェアされた干渉像の光強度データが得られているので、b 方向と同じようにして形状を計算する.

#### 3. 実 夏

#### 3.1 実験装置

実験に用いた測定光学系(上方から見た光学素子配置図)を 図3に示す.半導体レーザは電流注入により波長が容易に可変 なファブリーペロ型(日立製HL7851G:出力50mW)を用い, レーザからの発散ビーム光を大型レンズで平行光にしてからペ リクルビームスプリッタ(薄い膜からなるスプリッタで振動や 空気じょう乱の影響を受けやすい.しかし大口径で安価)を介 して観測方向より被測定物体に当てている.被測定物体はペリ クルビームスプリッタの前方約35cmに配置した.物体から観 測方向への反射光はペリクルビームスプリッタを通過して大型 キューブビームスプリッタに入る.図3の点線は黒色アクリル 板で作られた箱型のおおいであり,大型キューブビームスプリッ タ等からなる干渉計が外乱の影響を受けにくくなるようにして いる.図4に示すようにキューブビームスプリッタは圧電素子 で光軸方向に数μm移動できるようにしてあり,スプリッタの



**Fig.4** PZT actuator setup for phase shifting. Large beam splitter in Fig.3 is moved by PZT actuator. Light  $l_1$  reflected by the moved splitter takes path length shorter than that of light  $l_2$ 

向の距離sの移動は光路差をsだけ変化させる(sが数µmと小 さいため図4の4とし、に沿って進んだ光はほぼ同じ経路を走っ てカメラの同じ画素に入る.その結果,圧電素子が伸びること により」はL。に対しheの長さ、すなわちsだけ光路が短くなる). 大型ビームスプリッタを通過した2つの光はミラーにより倍率 の異なる2つの結像レンズにそれぞれに向けられる(図3)結 像レンズは同時期に購入した(同ロットと考えられる)ズーム ニッコール 35-105 であり、一方は測定対象物表面での 25mm × 25mm の領域を CCD カメラの画素 200 × 200 に取り込める よう,もう一方のズームレンズは10mm×10mmの領域を画 素200×200に取り込めるように調整した.ズームレンズによ る結像位置はレンズ背面から後方約50mmの所にあり、レンズ の口径が大きくて(直径50mm以上),小型ビームスプリッタ を介して2つの像をカメラ受光面にそのまま結像させることが できない.そこで後方に1倍のリレーレンズを入れ,リレーレ ンズ直後に小型ビームスプリッタを置いて2つの像をCCD 受光 面に正面から入射させている. 受光面の直前の偏光板は測定物 体での粗面反射で偏光方向が一部ランダムに変化し、受光面上 での2つの光が互いに異なる偏光成分を含み,結果として干渉 じまのビジビリティを下げることを回避するために入れている. 以上の光学系はマッハーツェンダー干渉計を含むものであって 完全な共通光路干渉計でない、しかし形状測定において最も問 題となる測定光学系と被測定物の間が共通光路となっておりマッ ハーツェンダー干渉計も外乱の影響を受けにくいようにしてあ る.このためラジアルシェア干渉計(共通光路干渉計)の特徴 を持つものとしてここでは取り扱った.

コンピュータに装着された画像取込みボードは64Mbyteのメ モリを搭載しており,圧電素子でビームスプリッタをゆっくり 移動し続けた時の干渉画像を30枚/sの速度で連続して128枚 コンピュータへ取り込める.取り込んだ画像は取込み順に10枚 ずつ平均し(ランダムノイズを抑えるため),平均画像から同一 画素でのビームスプリッタの移動に伴う光強度の変化を調べ、そ れぞれ π/2の位相差を持つ平均画像を5枚抜き出してハリハラ ン法<sup>7</sup>を用いて位相を評価した.

半導体レーザの発振波長は、あらかじめ250mm 焦点の分光 器で注入電流と発振波長の変化の関係を求めておき、実際の測 定ではこの関係を利用して注入電流から計算している。以下に 述べる形状測定で用いた波長は入1=782.30、入2=782.36nm で あり、波長変化は0.1 nm以下となっている。一般に半導体レー ザの発振波長は素子の温度と注入電流によって変化することが 知られている。故に素子には温度制御器を付けるべきだろうが、



Fig.5 The first measured object





装置は高価であって測定原理の検証には必ずしも必要でないた め本実験では用いていない.

#### 3.2 測定結果

本実験で最初に測定したのは直角を挟んで20mm×20mmの 幅面を持つ直角三角柱に酸化マグネシウムの粉を吹き付けた粗 面である(図5). 直角三角柱の材料は木である. 3つの平行な 稜が垂直方向に立ち、直角に接する稜が視野中心に来るように して形状を測定した.ハリハラン法を用いて2つの波長で位相 をそれぞれ測定して式(7)で与えられる位相の差を描画した結果 を図6に示す.図6は図5に示した物体を手前上方から見た時 の10mm×10mm(画素80×80)の領域の位相の差を示して おり、ランダムな雑音成分をなるべく除去するために測定点を 中心とする3画素×3画素の領域で位相差データを平均してい る. この結果には位相の飛び(位相値の変化に伴う-πからπ の飛び,またはその逆の飛び)があるので飛びをアンラップ(飛 びのない画像に回復)し、アンラップ結果を基に式(3)の左辺を 計算(式(7)からg(x)を求めて計算)した.式(3)の左辺から右辺 第2項のf(x)を計算した結果を図7に示す. 横方向はメッシュ が見やすくなるように2画素×2画素分を1メッシュで示した. 式(3)の左辺に関しては g(a<sup>n</sup>x.a<sup>n</sup>y) の a<sup>n</sup>x.a<sup>n</sup>y が 0.5 (ピクセル) 以下になった時点でそれ以上の計算を終了した. また計算には, ピクセルの中心座標以外の位置でのg(x.y)も必要になる.この



Fig.7 Measured shape. x range (from 0 to 40) and z range (from -200 to 50) correspond to 10mm and 8mm long respectively

場合は計算位置を取り巻く4ピクセル位置でのg(x.y)を基に,計 算位置と4ピクセル中心位置までの距離情報を基に g(x.y)を内 挿計算している.

これらの形状計測の測定精度は用いる波長と波長差<sup>4</sup>,取込 画像に含まれるランダムノイズの強度(故に半導体レーザの出 カやレンズの絞り)等に強く依存する.故に形状計測の手法に よる測定精度を抜き出して評価することは難しい.しかし本方 法で得られる計測精度については何らかの評価が必要と思われ る.そこで我々は図7の測定結果から測定精度の評価を行った. 図7では三角柱を測定しているが、その斜面は完全な平面であ ると仮定し、測定結果に最も近い完全平面と測定結果を比較し てそのずれの標準偏差を求めた.その結果から標準偏差は 0.14mmであることが分かった.この値は横方向の平均処理か ら横分解能が(25mm/200)×3=0.4mmとして得られたもの である.

三角柱以外に高圧ガスのバルブキャップの一部も形状測定した.表面には酸化マグネシウムの粉を吹き付け同様な条件で測定した結果を図8に示す.また図9には2次元変化を持つ身近なものとしてガラスビーカを取り上げてその注ぎ口付近を計測した結果を示す.

共に途中でシェア方向を変えることなく,ビーカの注ぎ口で は二次元的な変化を有する形状が測定できている.

これらはすべて被測定物と測定光学系の間がオープンな環境 でペリクルビームスプリッタを使用して測定できており、実験 装置の耐振動性や耐空気じょう乱性が高いことを示すものであ る.

#### 4. 結 🕷

以上の本論文の内容は以下のようにまとめることができる.

- (1)本論文では、レーザ光の照射と反射光の測定が同方向から行い得、測定光学系と被測定物間の距離が長くても外部振動や空気じょう乱の影響を受けにくい共通光路干渉計を利用した粗面物体の形状計測法を新たに提案し、形状測定が可能であることを確認した。
- (2) この方法ではラジアルシェア干渉計を使用することで2 次元的形状変化を有する粗面物体も測定できた(我々の知る限り共通光路干渉計を利用した粗面物体の形状測定では、



Fig.8 Measured shape of a part of cylinderical gas valve cover. x range corresponds to 10mm long and z range corresponds to 6mm long



Fig.9 Measured shape of a pouring part of a beaker. x range corresponds to 10mm long and z range corresponds to 4 mm long 1 方向にシェアを与えて測定する方法しか報告例がなく,1 次元的変化(シェア方向の変化)を有する物体しかこれま でに測定できていない(例えば文献11)).

(3)また可動部はビームスプリッタ部分にしかなく、移動量 も数µm前後であって駆動に圧電素子を用いているために 機械的なガタは発生しにくく、繰り返し使用に耐える構造 となっている.



- K. J. Gasvik: Optical Metrology, 2nd Ed., John Wiley & Sons Ltd., (1995) 161.
- 大澤尊光,浅野秀光,古谷涼秋,高増 潔,大園成夫:多 値パターン投影による3次元形状測定(第3報),精密工学会 誌,64,2(1998)236.
- T.Maack, G. Notni and W. Schreiber: Three-coordinate Measurement of an Object Surface with a Combined Two-wavelength and Two-source Phase-shifting Speckle Interferometer, Opt. Commun., 115, (1995) 576.
- 4)安達正明,稲部勝幸:半導体レーザを用いた段差を持つ粗 面の形状計測 -3波長での位相測定を用いる方法- 精密 工学会誌,65,3(1999)418.
- S. Kuwamura and I. Yamaguchi: Wavelength Scanning Profilometry for Real-time Surface Shape Measurement, Appl. Opt., 36, 19 (1997) 4473.
- 6)河野嗣男,松本大司,細越剛史,矢沢孝哲,宇田豊:ラジアルシェア干渉計によるオンマシン測定,精密工学会誌, 65,3 (1999) 443.
- P.Hariharan, B.F.Oreb and T.Eiju: Digital Phase -Shifting Interferometry - A Simple Error - Compesating Phase Calculation Algorithm-, Appl. Opt., 26, (1987) 2504.
- 8) 大杉博人,安達正明,稲部勝幸:シェアログラフィを利用 した形状計測,1997年度精密工学会秋季大会学術講演会講 演論文集,(1997)461.
- 9) 平林 崇,安達正明,稲部勝幸:ラジアルシェア干渉計を 用いた粗面物体の3次元形状測定法,1998年度精密工学会 秋季大会学術講演会講演論文集,(1998)184.
- G.Parry: Some Effects of Surface Roughness on the Appearance of Speckle in Polychromatic Light, Opt. Commun., 12, (1974) 78.
- 11) P. K. Rastogi : An Electronic Pattern Speckle Shearing Interferometer for the Measurement of Surface Slope Variations of Threedimensional Objects, Opt. and Lasers in Eng., 26, (1997) 93.